

Reference Number: PA211-1292

Dispatch Number: 094869

Dispatch Date: February 24, 2009

Notification of Reasons for Refusal

Patent Application No. 2004-018145

Drafting Date: February 21, 2009

Examiner of the JPO: Jun-ichi Imai 9055 4R00

Applicant for Patent: Tosoh Corporation

Applied Provisions: Patent Law Sections 29(2) and 36

The subject application is to be rejected because of following reasons. In the case of an opinion thereon, submit a written opinion within 60 days from the mailing date of this notification.

Reasons

- 1) The invention in the claims listed below of the subject application should not be granted a patent under the provision of Patent Law Section 29(2) since it could have easily been made by persons who have common knowledge in the technical field to which the invention pertains, on the basis of the inventions

described in the publications 1 to 3 listed below which were distributed in Japan or foreign countries or those being able to be utilized to the public via telecommunication line prior to the filing of the subject application.

2) Description of claims of this application does not comply with the requirements under the provision of Patent Law Section 36(6)(2) on the points mentioned below.

3) Description of "Detailed Description of the Invention" of this application does not comply with the requirements under the provision of Patent Law Section 36(4) on the points mentioned below.

Note (List of Cited Document is listed below)

Claims 1 and 7

Reason 1)

Cited Documents 1 and 2

In [0011] to [0036] of the cited document 1, there is a description for a jig in a semiconductor manufacturing device being coated with Cs- or Fe-containing alumina silicate glass or zirconia silicate glass and having an excellent resistance to plasma and, in [0011] to [0023] of the cited document 2, there is a description that gas containing alumina or zirconia is thermally sprayed.

Claims 2, 3 and 4

Reason 1)

Cited documents 1 to 3

From line 12, upper left column, page 2 to line 3, upper right column, page 3 of the cited document 3, there is a description for a glass base material containing a predetermined amount of alumina with zirconia, yttria, etc.

Claim 11

Reason 2)

With regard to the passage reading "a most superficial layer of the sprayed coating forms a spherical protruded layer in which the concentration of at least one of aluminum or zirconium and elements of the group 2a, group 3a and group 4a is lower than that of the internal sprayed coating" mentioned in claim 11, it is ambiguous whether the "most superficial layer of the spray coating" forms the "spherical protruded layer" or "the concentration of at least one of aluminum or zirconium and elements of the group 2a, group 3a and group 4a" forms the "spherical protruded layer". To begin with, it is ambiguous in what meaning the phrase "concentration... is lower" is related to the phrase "... forms a spherical protruded layer".

Accordingly, the invention in claim 11 is not clear.

Claim 11

Reason 3)

With regard to the description of [0050] to [0051] corresponding to the passage reading "a most superficial layer of the sprayed coating forms a spherical protruded layer in which the concentration of at least one of aluminum or zirconium and elements of the group 2a, group 3a and group 4a is lower than that of the internal sprayed coating" mentioned in claim 11, there is no description for a specific method which embodies the feature that "the concentration of at least one of aluminum or zirconium and elements of the groups 2a, group 3a and group 4a becomes low" whereby persons skilled in the art are unable to carry out it.

Accordingly, the Detailed Description of Invention of this application does not clearly and fully describes to such an extent that persons skilled in the art are able to carry out the invention in claim 11.

< Claims for which no reason for refusal is found >

For claims 5, 6, 8, 9 and 10, no reason for refusal is found at present. If any reason for refusal is found later, it will be notified.

#### List of Cited Documents

1. Gazette of JP-A-2002-220252

2. Gazette of JP-A-2002-134481

3. Gazette of JP-A-59-069441

-----

-

Record of the Result of Prior Art Search

. Technical Field Searched:

IPC (seventh edition) H 01 L 21/3065

This record does not constitute the reason for refusal.

整理番号 PA211-1292

発送番号 094869 1/  
発送日 平成21年 2月24日

## 拒絶理由通知書

200-2597US

大賀

特許出願の番号

特願2004-018145

起案日

平成21年 2月12日

特許庁審査官

今井 淳一 9055 4R00

特許出願人

東ソー株式会社 様

適用条文

第29条第2項、第36条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出してください。



## 理由

- 1) この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記1～3の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
- 2) この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
- 3) この出願は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で、特許法第36条第4項に規定する要件を満たしていない。

記（引用文献等については引用文献等一覧参照）

請求項1, 7

理由1)

引用文献1, 2

引用文献1の【0011】～【0036】には、CsやFeを含んだアルミナシリケートガラスやジルコニアシリケートガラスを被覆した、プラズマ耐性に優れた半導体製造装置内の治具が記載されており、引用文献2の【0011】～【0023】には、アルミナやジルコニアを含んだガスを溶射することが記載されている。

請求項2, 3, 4

理由1)

引用文献1～3

引用文献3の第2頁左上欄第12行～第3頁右上欄第3行には、アルミナとジル

整理番号 PA211-1292

発送番号 094869 2/E

発送日 平成21年 2月24日

コニア、イットリア等を所定量含んだガラス素材が記載されている。

## 請求項11

## 理由2)

請求項11に記載された「溶射膜最表面層が内部溶射膜よりもアルミニウム又はジルコニウム及び2a族及び3a族及び4a族の元素のうち少なくとも一つの濃度が低い球状突起層を形成した」は、「溶射膜最表面層」が「球状突起層」を形成しているのか、それとも、「アルミニウム又はジルコニウム及び2a族及び3a族及び4a族の元素のうち少なくとも一つの濃度」が「低い球状突起層」を形成しているのか不明であり、そもそも、「濃度が低い」と「球状突起層を形成」とはいかなる意味で関係するのか不明である。

よって、請求項11に係る発明は明確でない。

## 請求項11

## 理由3)

請求項11に記載された「溶射膜最表面層が内部溶射膜よりもアルミニウム又はジルコニウム及び2a族及び3a族及び4a族の元素のうち少なくとも一つの濃度が低い球状突起層を形成した」に対応した【0050】～【0051】の記載は、「アルミニウム又はジルコニウム及び2a族及び3a族及び4a族のうち少なくとも1つの元素の濃度が低くなる」を実現する具体的な方法が記載されていないので、当業者がこれを実施することができない。

よって、この出願の発明の詳細な説明は、当業者が請求項11に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されていない。

## &lt;拒絶の理由を発見しない請求項&gt;

請求項5, 6, 8, 9, 10に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

## 引用文献等一覧

1. 特開2002-220252号公報
2. 特開2002-134481号公報
3. 特開昭59-69441号公報

## 先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 IPC第7版 H01L21/3065

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。